BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-293824

(P2002-293824A)

(43)公開日 平成14年10月9日(2002.10.9)

(51) Int.Cl.7

CO8F 8/42

識別記号

FI

テーマコード(参考)

C08F 8/42

4J100

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 10 頁)

(21)出願番号	特顧2002-14504(P2002-14504)	(71)出顧人	000005201
			富士写真フイルム株式会社
(22)出願日	平成14年1月23日(2002.1.23)		神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者	山崎 純明
(31)優先権主張番号	特顧2001-15912(P2001-15912)		静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
(32)優先日	平成13年1月24日(2001.1.24)		真フイルム株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	川村 浩一
			静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
			真フイルム株式会社内
		(74)代理人	100105647
			弁理士 小栗 昌平 (外4名)
		1	

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 シランカップリング基末端の親水性ポリマー

(57)【要約】

【課題】 防曇塗料、外装防汚塗料等に利用できる新規なシランカップリング基末端を有する親水性ポリマーを得る。

【解決手段】 下記i)、ii)からなる。

i) - (CHR³-CR⁴(-L¹-Y¹))_x-(CHR⁵-CR⁶(-L²-Y²))_y-で表されるポリマーユニット、
ii) 上記ポリマー末端に-L³-Si(R¹)_a(OR²)
2-aで表されるシランカップリング基を有する

3-mで表されるシランカップリング基を有する。 R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR⁶はそれぞれ独立に水素原子又は炭素数 $1\sim8$ の炭化水素基を表し、mは 0、 1 または 2 を表し、nは $1\sim8$ の整数を表し、xは 1 0 $0\sim1$ mol%、yは $0\sim9$ 9 mol%の範囲を表す。L¹、L²、L³はそれぞれ独立に単結合又は有機連結基を表し、Y¹、Y²はそれぞれ独立に一N(R²)(R²)、一OH、-NHCOR²、-COR²、-CO2M又は-SO3Mを表し、ここで、R²、R²はそれぞれ独立に水素原子又は炭素数 $1\sim8$ のアルキル基を表し、Mは水素原子、アルカリ金属、アルカリ土類金属又はオニウムを表す。

pra

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記i)、ii)からなる高分子化合物。 $i) - (CHR^3 - CR^4 (-L^1 - Y^1))_{\mathbf{r}} - (CHR^5 CR^{6}(-L^{2}-Y^{2}))$ yーで表されるポリマーユニット、 ii)上記ポリマー末端に-L3-Si(R1)a(OR2) 3-mで表されるシランカップリング基を有する。

1

R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR⁶はそれぞれ独立に水 素原子又は炭素数1~8の炭化水素基を表し、mは0. 1または2を表し、nは1~8の整数を表し、xは10 0~1 mol%、yは0~99mol%の範囲を表す。L¹、 L²、L³はそれぞれ独立に単結合又は有機連結基を表 し、 Y^1 、 Y^2 はそれぞれ独立に $-N(R^7)(R^8)$ 、-OH、-NHCOR⁷、-COR⁷、-CO₂M又は-S O₃ Mを表し、ここで、R⁷、R⁸はそれぞれ独立に水素 原子又は炭素数1~8のアルキル基を表し、Mは水素原 子、アルカリ金属、アルカリ土類金属又はオニウムを表 す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、防嚢塗料、外装防 20 汚塗料等に利用できる新規なシランカップリング基末端 を有する親水性ポリマーに関する。

[0002]

【従来の技術】従来から親水性ポリマーとして種々のポ リマーが知られているが、シランカップリング基を末端 に有する親水性ポリマーについては知られていない。か かる親水性ポリマーは、防曇塗料、外装防汚塗料等に広 く利用でき、有用である。

[0003]

【化1】 (1)

【0008】上記式(1)で表わされる高分子化合物 は、その右側末端として、水素原子、一L3-Si (R1) m (OR2) 3-m で表されるシランカップリング 基、重合開始剤のいずれかを有していてもよい。

する親水性ポリマーは、例えば基材表面に導入すると基 材表面が高度に親水化される。例えば本発明のポリマー を含有する塗料を基材上に塗布することにより、基材表 面が高度に親水化され、基材に水滴が付着しても、水滴 が基材表面に一様に広がるので、ガラス、レンズ、鏡等 の曇りを有効に防止でき、湿分による失透防止、雨天時 の視界性確保に役立つ。更に、都市煤塵、自動車等の排 気ガスに含有されるカーボンブラック等の燃焼生成物、 油脂、シーラント溶出成分等の疎水性汚染物質が付着し

*【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は防曇 塗料、外装防汚塗料等に利用できる新規なシランカップ リング基末端を有する親水性ポリマーを提供することを 目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記新規親水性ポリマー は、下記i) からなる高分子化合物である。

i) - $(CHR^3-CR^4(-L^1-Y^1))_x-(CHR^5 CR^{6}(-L^{2}-Y^{2}))$ yーで表されるポリマーユニット、 10 ii)上記ポリマー末端に-L³-Si(R¹)。(OR²) 3-aで表されるシランカップリング基を有する。

【0005】R1、R2、R3、R4、R5およびR6はそれ ぞれ独立に水素原子又は炭素数1~8の炭化水素基を表 し、mは0、1または2を表し、nは1~8の整数を表 し、xは100~1mol%、yは0~99mol%の範囲を 表す。L1、L2、L3はそれぞれ独立に単結合又は有機 連結基を表し、 Y^1 、 Y^2 はそれぞれ独立に-N(R^7) (R^8) , -OH, $-NHCOR^7$, $-COR^7$, $-CO_2$ M又は-SO₃Mを表し、ここで、R⁷、R⁸はそれぞれ 独立に水素原子又は炭素数1~8のアルキル基を表し、 Mは水素原子、アルカリ金属、アルカリ土類金属又はオ ニウムを表す。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の親水性ポリマーに ついて詳述する。本明細書では、本発明の親水性ポリマ ーを、便宜上、下記一般式(1)で表わすこともでき

[0007]

※ができる。

【0010】上記一般式(1)において、R¹、R²、R 3、R4、R5およびR6はそれぞれ水素原子又は炭素数8 以下の炭化水素基を表し、炭素数8以下の炭化水素基と 【0009】本発明のシランカップリング基を末端に有 40 しては、炭素数8以下の直鎖、分岐又は環状のアルキル 基が好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、プロ ピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル 基、オクチル基、イソプロピル基、イソブチル基、s-ブ チル基、t-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル 基、1-メチルブチル基、イソヘキシル基、2-エチル ヘキシル基、2-メチルヘキシル基、シクロペンチル基 等が挙げられる。これらの炭化水素基は更に置換基を有 していてもよい。好ましくは水素原子、メチル基又はエ チル甚である。

にくく、付着しても降雨や水洗により簡単に落とすこと※50 【 0 0 1 1 】 L¹およびL²は単結合又は有機連結基を表

す。ここで、有機連結基とは、非金属原子からなる多価 の連結基を示し、具体的には、1個から60個までの炭 素原子、0個から10個までの窒素原子、0個から50 個までの酸素原子、1個から100個までの水素原子、 及び0個から20個までの硫黄原子から成り立つもので*

3

*ある。より具体的な連結基としては下記の構造単位また はこれらが組合わさって構成されるものを挙げることが

[0012]

【0013】 Y^1 、 Y^2 はそれぞれ独立に $-N(R^7)$ (R^8) , -OH, $-NHCOR^7$, $-COR^7$, $-CO_2$ M又は-SO₃Mを表し、ここで、R⁷、R⁸はそれぞれ 独立に水素原子又は炭素数1~8のアルキル基を表し、 Mは水素原子、アルカリ金属、アルカリ土類金属又はオ ニウムを表す。また、 $-N(R^7)(R^8)$ について R7、R8がお互い結合して環を形成していてもよく、ま た、形成された環は酸素原子、硫黄原子、窒素原子など のヘテロ原子を含むヘテロ環であってもよい。

素原子又は炭素数8以下の炭化水素基を表す。炭化水素 基としては、アルキル基、アリール基などが挙げられ、 炭素数8以下の直鎖、分岐又は環状のアルキル基が好ま しい。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、 ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オク チル基、イソプロピル基、イソブチル基、sーブチル 基、セーブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、 1-メチルブチル基、イソヘキシル基、2-エチルヘキ シル基、2一メチルヘキシル基、シクロペンチル基等が 挙げられる。

【0015】これらの炭化水素基は更に置換基を有して いてもよい。アルキル基が置換基を有するとき、置換ア ルキル基は置換基とアルキレン基との結合により構成さ れ、ここで、置換基としては、水素を除く一価の非金属 原子団が用いらる。好ましい例としては、ハロゲン原子 (一F、一Br、一Cl、一I)、ヒドロキシル基、ア ルコキシ基、アリーロキシ基、メルカプト基、アルキル チオ基、アリールチオ基、アルキルジチオ基、アリール ジチオ基、アミノ基、N-アルキルアミノ基、N, N-ジアリールアミノ基、Nーアルキル-N-アリールアミ※50

※ノ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、N-ア ルキルカルバモイルオキシ基、N-アリールカルバモイ ルオキシ基、N、Nージアルキルカルバモイルオキシ 基、N、Nージアリールカルバモイルオキシ基、N-ア ルキルーNーアリールカルバモイルオキシ基、アルキル スルホキシ基、アリールスルホキシ基、アシルチオ基、 アシルアミノ基、Nーアルキルアシルアミノ基、Nーア リールアシルアミノ基、ウレイド基、N'ーアルキルウ レイド基、N', N'ージアルキルウレイド基、N'ー 【0014】R7およびR8としてはそれぞれ独立に、水 30 アリールウレイド基、N', N'-ジアリールウレイド 基、N'ーアルキル-N'ーアリールウレイド基、N-アルキルウレイド基、

【0016】N-アリールウレイド基、N'-アルキル

-N-アルキルウレイド基、N'-アルキル-N-アリ ールウレイド基、N', N'-ジアルキル-N-アルキ ルウレイト基、N', N'-ジアルキル-N-アリール ウレイド基、N'-アリール-N-アルキルウレイド 基、N'~アリール-N-アリールウレイド基、N', N'ージアリール-N-アルキルウレイド基、N', 40 N'ージアリール-N-アリールウレイド基、N'-ア ルキル-N'-アリール-N-アルキルウレイド基、 N'-アルキル-N'-アリール-N-アリールウレイ ド基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリーロキシカ ルボニルアミノ基、N-アルキル-N-アルコキシカル ボニルアミノ基、Nーアルキル-N-アリーロキシカル ボニルアミノ基、N-アリール-N-アルコキシカルボ ニルアミノ基、Nーアリール-N-アリーロキシカルボ ニルアミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル

【0017】アルコキシカルボニル基、アリーロキシカ

きる。

ルボニル基、カルバモイル基、Nーアルキルカルバモイ ル基、N、Nージアルキルカルバモイル基、Nーアリー ルカルバモイル基、N、N一ジアリールカルバモイル 基、Nーアルキル-N-アリールカルバモイル基、アル キルスルフィニル基、アリールスルフィニル基、アルキ ルスルホニル基、アリールスルホニル基、スルホ基 (一 SO₃H)及びその共役塩基基(以下、スルホナト基と 称す)、アルコキシスルホニル基、アリーロキシスルホ ニル基、スルフィナモイル基、Nーアルキルスルフィナ ーアリールスルフィナモイル基、N, N-ジアリールス ルフィナモイル基、N-アルキル-N-アリールスルフ ィナモイル基、スルファモイル基、Nーアルキルスルフ ァモイル基、N、Nージアルキルスルファモイル基、N ーアリールスルファモイル基、N,N-ジアリールスル ファモイル基、Nーアルキル-N-アリールスルファモ イル基、ホスフォノ基 (-PO3H2) 及びその共役塩基 基(以下、ホスフォナト基と称す)、ジアルキルホスフ ォノ基(-PO3(alkyl)2)、ジアリールホスフ スフォノ基(-PO3(alkyl)(aryl))、 モノアルキルホスフォノ基(-PO3H(alky 1))及びその共役塩基基(以後、アルキルホスフォナ ト基と称す)、モノアリールホスフォノ基 (-PO3H (aryl))及びその共役塩基基(以後、アリールホ スフォナト基と称す)、ホスフォノオキシ基(一〇P〇 3 H2) 及びその共役塩基基(以後、ホスフォナトオキシ 基と称す)、ジアルキルホスフォノオキシ基(一〇PO 3 (alkyl)2)、ジアリールホスフォノオキシ基 (-OPO3 (aryl)₂)、アルキルアリールホスフ 30 ォノオキシ基(-OPO(alkyl)(ary 1))、モノアルキルホスフォノオキシ基(-OPO3 H(alkyl))及びその共役塩基基(以後、アルキ ルホスフォナトオキシ基と称す)、モノアリールホスフ ォノオキシ基(一〇PO3 H(aryl))及びその共 役塩基基(以後、アリールフォスホナトオキシ基と称 す)、モルホルノ基、シアノ基、ニトロ基、アリール 基、アルケニル基、アルキニル基が挙げられる。

【0018】これらの置換基における、アルキル基の具 基の具体例としては、フェニル基、ビフェニル基、ナフ チル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、クメニル 基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、クロロメチ ルフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メトキシフェニ ル基、エトキシフェニル基、フェノキシフェニル基、ア セトキシフェニル基、ベンゾイロキシフェニル基、メチ ルチオフェニル基、フェニルチオフェニル基、メチルア ミノフェニル基、ジメチルアミノフェニル基、アセチル アミノフェニル基、カルボキシフェニル基、メトキシカ ルボニルフェニル基、エトキシフェニルカルボニル基、

フェノキシカルボニルフェニル基、N一フェニルカルバ モイルフェニル基、フェニル基、シアノフェニル基、ス ルホフェニル基、スルホナトフェニル基、ホスフォノフ ェニル基、ホスフォナトフェニル基等を挙げることがで きる。また、アルケニル基の例としては、ビニル基、1 ープロペニル基、1ーブテニル基、シンナミル基、2ー クロロー1-エテニル基等が挙げられ、アルキニル基の 例としては、エチニル基、1-プロピニル基、1-ブチ ニル基、トリメチルシリルエチニル基等が挙げられる。 モイル基、N, Nージアルキルスルフィナモイル基、N 10 アシル基 (G1CO-) におけるG1としては、水素、な らびに上記のアルキル基、アリール基を挙げることがで

【0019】これら置換基のうち、より好ましいものと してはハロゲン原子(一F、一Br、一Cl、一I)、 アルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルチオ基、アリ ールチオ基、N-アルキルアミノ基、N, N-ジアルキ ルアミノ基、アシルオキシ基、Nーアルキルカルバモイ ルオキシ基、N一アリールカバモイルオキシ基、アシル アミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル基、ア ォノ基(-PO3(aryl)2)、アルキルアリールホ 20 ルコキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、カ ルバモイル基、N-アルキルカルバモイル基、N, N-ジアルキルカルバモイル基、N一アリールカルバモイル 基、Nーアルキル-N-アリールカルバモイル基、スル ホ基、スルホナト基、スルファモイル基、Nーアルキル スルファモイル基、N, N—ジアルキルスルファモイル 基、N-アリールスルファモイル基、N-アルキル-N 一アリールスルファモイル基、ホスフォノ基、ホスフォ ナト基、ジアルキルホスフォノ基、ジアリールホスフォ ノ基、モノアルキルホスフォノ基、アルキルホスフォナ ト基、モノアリールホスフォノ基、アリールホスフォナ ト基、ホスフォノオキシ基、ホスフォナトオキシ基、ア リール基、アルケニル基が挙げられる。

【0020】一方、置換アルキル基におけるアルキレン 基としては前述の炭素数1から20までのアルキル基上 の水素原子のいずれか1つを除し、2価の有機残基とし たものを挙げることができ、好ましくは炭素原子数1か ら12までの直鎖状、炭素原子数3から12まての分岐 状ならびに炭素原子数5から10までの環状のアルキレ ン基を挙げることができる。該置換基とアルキレン基を 体例としては、前述のアルキル基が挙げられ、アリール 40 組み合わせる事により得られる置換アルキル基の、好ま しい具体例としては、クロロメチル基、ブロモメチル 基、2-クロロエチル基、トリフルオロメチル基、メト キシメチル基、メトキシエトキシエチル基、アリルオキ シメチル基、フェノキシメチル基、メチルチオメチル と、トリルチオメチル基、エチルアミノエチル基、ジエ チルアミノプロピル基、モルホリノプロピル基、アセチ ルオキシメチル基、ベンゾイルオキシメチル基、Nーシ クロヘキシルカルバモイルオキシエチル基、N—フェニ ルカルバモイルオキシエチルル基、アセチルアミノエチ 50 ル基、N-メチルベンゾイルアミノプロピル基、2-オ

キシエチル基、2-オキシプロピル基、カルボキシプロピル基、メトキシカルボニルエチル基、アリルオキシカルボニルブチル基、アリルオキシカルボニルブチル基、

【0021】クロロフェノキシカルボニルメチル基、カ ルバモイルメチル基、N-メチルカルバモイルエチル 基、N, N-ジプロピルカルバモイルメチル基、N-(メトキシフェニル) カルバモイルエチル基、N-メチ ルーN-(スルホフェニル)カルバモイルメチル基、ス ルホブチル基、スルホナトブチル基、スルファモイルブ チル基、N-エチルスルファモイルメチル基、N, N- 10 ジプロピルスルファモイルプロピル基、N-トリルスル ファモイルプロピル基、N-メチル-N-(ホスフォノ フェニル) スルファモイルオクチル基、ホスフォノブチ ル基、ホスフォナトヘキシル基、ジエチルホスフォノブ チル基、ジフェニルホスフォノプロピル基、メチルホス フォノブチル基、メチルホスフォナトブチル基、トリル ホスフォノヘキシル基、トリルホスフォナトヘキシル 基、ホスフォノオキシプロピル基、ホスフォナトオキシ ブチル基、ベンジル基、フェネチル基、αーメチルベン ジル基、1-メチル-1-フェニルエチル基、p-メチ 20 ルベンジル基、シンナミル基、アリル基、1-プロペニ ルメチル基、2-ブテニル基、2-メチルアリル基、2 -メチルプロペニルメチル基、2-プロピニル基、2-ブチニル基、3-ブチニル基等を挙げることができる。 【0022】本発明の親水性ポリマーの具体例を以下に 示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。 [0023]

【化3】

【0024】 【化4】

30

9

17
$$(MeO)_3Si$$
 $S \leftarrow CH(CH_3)_2$

[0025]

30【化5】

19
$$(MeO)_3Si$$
 $S \leftarrow 0$ $(MeO)_3Si$ $S \leftarrow 0$ $(MeO)_3Si$ $S \leftarrow 0$ $(MeO)_3Si$ $($

21
$$(MeO)_3S$$
 $(MeO)_3S$ $(MeO)_$

【0026】本発明の親水性ポリマーは、下記一般式 (2)、(3)で表される不飽和化合物と、下記一般式 (4)で表されるメルカプト基を有するシラン化合物を 30 用いてラジカル重合により合成することができる。メル カプト基を有するシラン化合物(4)が連鎖移動能を有 するため、ラジカル重合においてポリマー主鎖末端にシ ランカップリング基が導入されたポリマーを合成するこ とができる。

[0027]

【化6】 (2)

$$(R^1)_m(OR^2)_{3-m}$$
 Si L^3 S H (4)

【0028】上記式(2)、(3)及び(4)におい

*式(1)と同義である。また、これらの化合物は市販さ れており、また、容易に合成することができる。

【〇〇29】(反応様式)一般式(4)で表されるメル カプト基を有するシラン化合物と、一般式(2)、

(3)で表される不飽和化合物とをラジカル反応させる 際の反応様式は特に制限されるものではなく、ラジカル 開始剤の存在下、あるいは高圧水銀灯等の照射下、例え ば、バルク反応あるいは溶液反応あるいは懸濁反応(乳 化反応)等を行うのが好ましい。また、重合方式につい ても、回分式(分割添加法や逐次添加法を含む)、半連 続式または連続式など、目的に応じて適宜選択すること ができる。特に、不飽和化合物の分割添加法(分割チャ 40 ージと称する場合もある)や逐次添加法(インクレメン ト法と称する場合もある)は一般式(2)、(3)で表 される不飽和化合物の単独重合を効率的に抑制すること ができることから好ましい重合方法である。例えば、一 般式(4)で表されるメルカプト基を有するシラン化合 物と一般式(2)、(3)で表される飽和化合物とをラ ジカル重合させる場合(モル比1:1)、重合温度条件 等にもよるが、1段階でこれらをラジカル重合すると一 般式(2)、(3)で表される不飽和化合物の単独重合 物が10重量%程度生成する場合があることが知られて て、 $R^1 \sim R^6$ 、 L^1 、 L^2 、 Y^1 、 Y^2 、n 及びmは、上記 * 50 いる。それに対して、分割添加法を採用し、一例として

3段階に分けてこれらをラジカル重合すると、同一重合 温度条件等において、一般式(2)、(3)で表される 不飽和化合物における単独重合物の生成量を10重量% 未満に低下させることが容易にできる。

【0030】(反応比率)一般式(4)で表されるメル カプト基を有するシラン化合物と、一般式(2)、

(3)で表される不飽和化合物との反応比率についても 特に制限されるものではないが、例えば、一般式 (4) で表されるメルカプト基を有するシラン化合物1モルに 対して、一般式(2)、(3)で表される不飽和化合物 10 ーフェニルプロピオンアミジン)ジヒドロクロライド、 の反応量をそれぞれ0.5~50モルの範囲内の値とす るのが好ましい。この理由は、かかる反応比率がこれら の範囲外となると、副反応が生じやすくなり、加水分解 性シラン化合物の収率が低下する場合があるためであ る。したがって、一般式(2)、(3)で表される不飽 和化合物の反応量を、一般式(4)で表されるメルカプ ト基を有するシラン化合物1モルに対して、1~45モ ルの範囲内の値とするのがより好ましく、5~40モル の範囲内の値とするのがさらに好ましい。一般式

いても制限されるものではないが、一般式(2)で表さ れる不飽和化合物の反応量を一般式(2)、(3)で表 される不飽和化合物合計量100モルに対して100~ 1モルの範囲内の値とするのがより好ましく、100~ 5モルの範囲内の値とするのがさらに好ましい。

【0031】(ラジカル開始剤)また、ラジカル開始剤 としては、アゾ系のラジカル開始剤または有機過酸化物 が好ましく、より好ましくはアゾ系のラジカル開始剤で ある。具体的に、好ましいアゾ系のラジカル開始剤とし ては、2,2′-アゾビスイソブチロニトリル、1, 1′ーアゾビス(シクロヘキサン-1-カルボニトリ (4-x)1、2、2、-アゾビス(4-xトキシ-2、4-ジ メチルバレロニトリル)、2,21-アゾビス(2,4 ージメチルバレロニトリル)、2,2'ーアゾビス(2 ーメチルブチロニトリル)、1-[(1-シアノ-1-メチルエチル)アゾ]ホルムアミド、2-フェニルアゾ -4-メトキシ-2, 4-ジメチルーバレロニトリル、 ジメチルー2,2'-アゾビス(2-メチルプロピオネ ート)、2,2'-アゾビス[2-メチル-N-[1, 1-ビス(ヒドロキシメチル)-2-ヒドロキシエチ ル] プロピオンアミド]、2,2'-アゾビス[2-メチ N-N-[1, 1-UZ(LFD+VJ+V)I+V]プロピオンアミド]、2,2'-アゾビス[2-メチル -N-(2-EFD+5)2, 2'-アゾビス[2-(5-メチル-2-イミダゾ リン-2-イル)プロパン]ジヒドロクロライド、2. 2'ーアゾビス[2-(2-イミダゾリン-2-イル) プロパン] ジヒドロクロライド、2,2'ーアゾビス [2-(4, 5, 6, 7-r)-r]-[14-1, 3]

ド、2,2'-アゾビス[2-(3,4,5,6-テト ラヒドロピリミジン-2-イル)プロパン]ジヒドロク ロライド、2, 2'ーアゾビス[2-(5-ヒドロキシ ル)プロパン] ジヒドロクロライド、2,2'ーアゾビ ス(2-[1-(2-ヒドロキシエチル)-2-イミダ ゾリンー2ーイル] プロパン]ジヒドロクロライド、 2, 2'-アゾビス[2-(2-イミダゾリン-2-イ ル)プロパン]、2,2'-アゾビス(2-メチル-N 2, 2'-アゾビス[N-(4-クロロフェニル)-2 -メチルプロピオンアミジン]ジヒドロクロライド、 2,2'-アゾビス[N-(4-ヒドロキシフェニル) -2-メチルプロピオンアミジン]ジヒドロクロライ ド、2,2'-アゾピス[2-メチル-N-(フェニル メチル)プロピオンアミジン]ジヒドロクロライド、 2, 2'-アゾビス[2-メチル-N-(2-プロペニ ル)プロピオンアミジン]ジヒドロクロライド、2, 2'-アゾビス(2-メチルプロピオンアミジン)ジヒ (2)、(3)で表される不飽和化合物の反応比率につ 20 ドロクロライド、2,2'-アゾビス[N-(2-ヒド ロキシエチル) -2-メチループロピオンアミジン] ジ ヒドロクロライド等の一種単独または二種以上の組み合 わせが挙げられる。

> 【0032】なお、ラジカル開始剤の添加量を、一般式 (2)、(3)で表される不飽和化合物と、一般式 (4)で表されるメルカプト基を有するシラン化合物と の合計量100重量部に対し、0.001~20重量部 の範囲内の値とするのが好ましく、0.1~10重量部 の範囲内の値とするのがより好ましく、0.1~5重量 30 部の範囲内の値とするのがさらに好ましい。

【0033】(反応温度)一般式(4)で表されるメル カプト基を有するシラン化合物と、一般式(2)、

(3)で表される不飽和化合物とを反応させる際の反応 温度は特に制限されるものではないが、例えば、-50 ~200℃の範囲内の値とするのが好ましい。この理由 は、反応温度が一50℃未満となると、これらの反応性 が著しく低下する場合があるためであり、一方、反応温 度が200℃を超えると、使用可能な溶媒の種類が過度 に制限されたり、あるいは副反応が生じやすくなる場合 40 があるためである。したがって、かかる反応温度を0~ 100℃の範囲内の値とするのがより好ましく、30~ 100℃の範囲内の値とするのがさらに好ましい。ま た、単独でのラジカル重合速度が速い不飽和化合物、例 えばアクリル酸を本発明における不飽和化合物として用 いる場合、反応温度を30~70℃の範囲内の値とする のが最も好ましい。このような反応温度とすることによ り、反応速度を低下させることなく、不飽和化合物の単 独重合をより効率的に抑制することができる。

【0034】(反応時間)反応時間については、反応温 ージアゼピンー2-イル)プロパン]ジヒドロクロライ 50 度等に依るが、反応の確実性と、生産性との関係から、

通常、○.5~1○○時間の範囲内の値とするのが好ま しく、1~24時間の範囲内の値とするのがより好まし

【0035】(溶媒)また、一般式(4)で表されるメ ルカプト基を有するシラン化合物と、一般式(2)、

(3)で表される不飽和化合物とを反応させる際に、こ れらを均一に反応させるために、溶媒を使用することが 好ましい。このような溶媒としては、乳酸エチル、メチ ルエチルケトン、シクロヘキサノン、ジメチルスルホキ シド、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテー 10 ト、ジエチルジグリコール、メチルプロピレングリコー ル、ジアセトンアルコール、メトキシプロピルアセテー ト、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテー ト、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、エチルー3-エトキシプロピオネート、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、N, N-ジメチルアセト $T \in \mathcal{F}$, 1, 3, $\mathcal{S} \times \mathcal{F} \times \mathcal{F} = 2 - 4 \in \mathcal{F} \times \mathcal{F}$ チルー3-メトキシプロピオネート、2-ヘプタノン、 トルエン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、クロロホ または二種以上の組み合わせが挙げられる。なお、溶媒 の使用量を、一般式(4)で表されるメルカプト基を持 つシラン化合物と、一般式(2)、(3)で表される不 飽和化合物との合計量を100重量部としたときに、1 ~10,000重量部の範囲内の値とするのが好まし く、50~1,000重量部の範囲内の値とするのがよ り好ましく、特に好ましくは50~800重量部の範囲 内の値とすることである。

【0036】(反応雰囲気)一般式(4)で表されるメ ルカプト基を有するシラン化合物と、一般式(2)、

(3)で表される不飽和化合物とを反応させる際の反応 雰囲気は特に制限されるものではないが、例えば、反応 系内を窒素バブリングしたり、あるいは超音波により脱 酸素処理を行ったのち、これらの化合物のラジカル反応 を行うことが好ましい。この理由は、このように窒素中 等でラジカル反応を行うと、メルカプト基同士のカップ リング反応に起因したジスルフィド化合物の生成を効率 的に抑制することができるためである。すなわち、メル カプト基のカップリング反応が生じると着色する場合が 多いが、それを有効に防止し、透明性の高い加水分解性 40 シラン化合物を得ることができる。また、反応雰囲気に 関して、反応系内に水が存在すると、ラジカル反応の段 階でアルコキシ基の加水分解が自発的に進みやすいとい う問題がある。特に、カルボキシ基を含有する加水分解 性シランをラジカル反応する場合、少量の水存在下であ ってもアルコキシ基の加水分解が容易に進行しやすくな る。このため、使用原料が液体の場合、例えば、モレキ ュラーシーブ、水素化カルシウム、硫酸マグネシウムな どの脱水剤を用いて脱水処理を施すか、あるいは必要に

16

め施すことがより好ましい。

【0037】本発明の親水性ポリマーの分子量として は、特に限定されないが、重量平均分子量として1,0 00~100,000が好ましく、1,000~50. 000がより好ましく、1,000~30,000がさ らに好ましい。本発明の親水性ポリマーは、上記の通り 基材表面に導入することにより、基材表面が高度に親水 化されるため、種々の塗料、とりわけ防曇塗料、外装防 汚塗料等に有効に利用することができる。

[0038]

【実施例】以下本発明を実施例により更に詳述する。 実施例1(高分子化合物1の合成)

500ml三口フラスコにアクリルアミド50g、メルカ プトプロピルトリメトキシシラン3.4g、及びジメチ ルホルムアミド220gを入れ、65℃窒素気流下、 2.2-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル) 0.5gを加えた。6時間攪拌しながら同温度に保った 後、室温まで冷却した。酢酸エチル2リットル中に投入

したことろ固体が析出した。乾燥後の重量は52.4g ルム、ヘキサン、メタノール、エタノール等の一種単独 20 であった。GPC(ポリスチレン標準)により重量平均 分子量3000のポリマーであり、13C-NMR (DM SO-d6)により末端にトリメトキシシリル基(5 Oppm)が導入されたポリマーであることが判明

> 【0039】実施例2(高分子化合物2~9の合成) アクリルアミドのかわりに対応するモノマーを用いたこ と以外は高分子化合物1と同様の方法で高分子化合物2 ~9の合成を行った。13C-NMRによりトリメトキシ シリル基が末端に導入されたポリマーであることをそれ 30 ぞれ確認した。表1にGPC (ポリスチレン標準) によ り求めた重量平均分子量を示す。

[0040]

【表1】

_ 我 1	
高分子化合物	重量平均分子量
2	4500
3	3300
4	4200
5	5600
6	6800
7	2200
8	3300
9	1900

【0041】実施例3(高分子化合物10の合成) 500ml三口フラスコにアクリルアミド50g、メルカ プトメチルメチルジエトキシシラン3.1g、及びジメ チルホルムアミド212gを入れ、65℃窒素気流下、 0.5gを加えた。6時間攪拌しながら同温度に保った 後、室温まで冷却した。酢酸エチル2リットル中に投入 応じ、これらの乾燥剤の存在下、窒素中で蒸留処理を予 50 したことろ固体が析出した。乾燥後の重量は50.5g

であった。GPC (ポリスチレン標準) により重量平均 分子量2500のポリマーであり、13C-NMR(DM SO-de)により末端にメチルジエトキシシリル基 (58.3ppm)が導入されたポリマーであることが 判明した。

【0042】実施例4(高分子化合物11の合成) 500ml三ロフラスコにアクリル酸50g、メルカプト プロピルメチルジメトキシシラン3.1g、及びジメチ ルホルムアミド212gを入れ、65℃窒素気流下、 0.5gを加えた。6時間攪拌しながら同温度に保った 後、室温まで冷却した。酢酸エチル2リットル中に投入 したことろ固体が析出した。乾燥後の重量49.5gで あった。GPC(ポリスチレン標準)により重量平均分 子量2700のポリマーであり、13C-NMR (DMS O-d6) により末端にメチルジメトキシシリル基(5) Oppm)が導入されたポリマーであることが判明 した。

【0043】実施例5(高分子化合物12~17の合 成)

アクリルアミドのかわりに対応するモノマー、ジメチル ホルムアミドのかわりにメタノール、2,2'-アゾビ A(2, 4-i)メチルバレロニトリル)のかわりに2. 2'-アゾビス(イソ酪酸)ジメチルを用いたこと以外 は高分子化合物1と同様の方法で高分子化合物12~1 7の合成を行った。13C-NMR (DMSO-d6) に よりトリメトキシシリル基(50.0ppm)が末端に 導入されたポリマーであることをそれぞれ確認した。表 2にGPC (ポリエチレングリコール標準) により求め た重量平均分子量を示す。

[0044]

【表2】

35.9

92. 2			
高分子化合物	重量平均分子量		
1 2	9,000		
1 3	11,000		
1 4	10,000		
1 5	8,000		
1 6	9,000		
17	11,000		

18

【0045】実施例6(高分子化合物18の合成) 500ml三口フラスコにメタノール135gを入れ、 60℃窒素気流下、アクリルアミド50g、N-ビニル ピロリドン8.7g、メルカプトプロピルトリメトキシ シラン7.7g、2,2'-アゾビス(イソ酪酸)ジメ チル0.54g、メタノール135gを2時間かけてゆ っくり滴下した。滴下後さらに4時間撹拌しながら同温 度に保った後、室温まで冷却した。アセトン2リットル 中に投入して固体を析出させた後、ろ過を行い、乾燥さ 2、2-アゾビス(2、4-ジメチルバレロニトリル)
 せた。乾燥後の重量は60.5gであった。GPC(ポ リエチレングリコール標準)により重量平均分子量9. 000のポリマーであり、13C-NMR (DMSO-d 6)によりトリメトキシシリル基(50.0ppm)が 末端に導入されたポリマーであることが判明した。

【0046】実施例7(高分子化合物19~23の合

アクリルアミド、Nービニルピロリドンのかわりに対応 するモノマーを用いたこと以外は高分子化合物18と同 様の方法で高分子化合物19~23の合成を行った。13 20 C-NMR (DMSO-d₆) によりトリメトキシシリ ル基(50.0ppm)が末端に導入されたポリマーで あることをそれぞれ確認した。表3にGPC(ポリエチ レングリコール標準)により求めた重量平均分子量を示

[0047]

【表3】

30

表3

高分子化合物	重量平均分子量
19	10,000
2 0	8,000
2 1	8,000
2 2	11,000
2 3	12,000

[0048]

【発明の効果】本発明に従い、防曇塗料、外装防汚塗料 等の各種塗料に有効に利用し得る、新規な親水性ポリマ 一を得ることができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J100 AD02P AF10P AJ02P AM15P

AM17P AM17Q AM19P AM21P AM21Q ANO4P AQ08P AQ08Q BA03P BA03Q BA14P BA56P BA77H BC79P CA01 CA04 CA31 DA36 FA04 HC78 HD08 JA01

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox